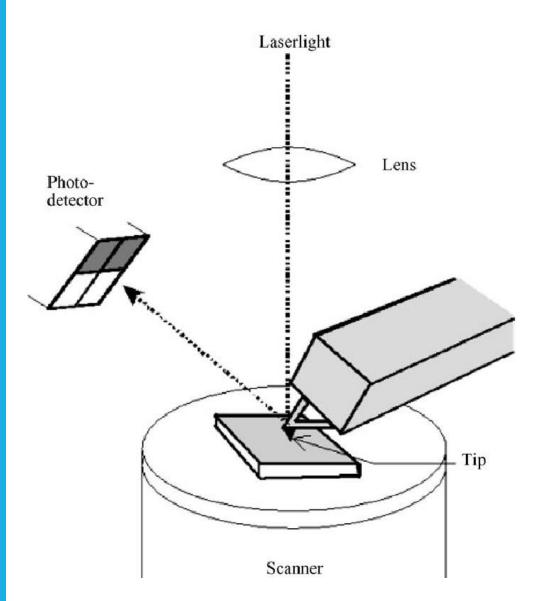
Elektrosztatikus mérés szimulációja multiprocesszoros környezetben

KÉSZÍTETTE: BAKRÓ NAGY ISTVÁN

KONZULENS: REICHARDT ANDRÁS (BME SZHVT)

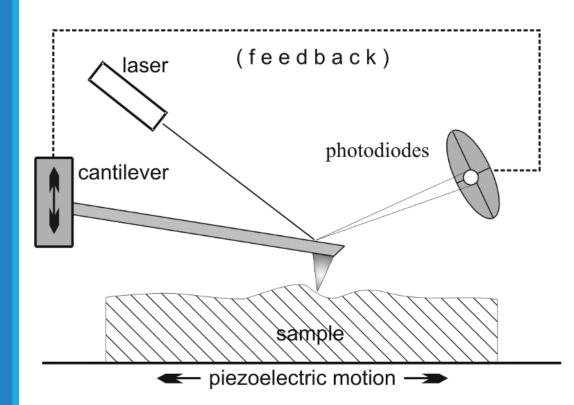
Az AFM apparátusa

- Minta mozgatása indirekt piezoelektromossággal
- Tű elmozdulásának mérése
- Tűre ható erő származtatása az elmozdulásából

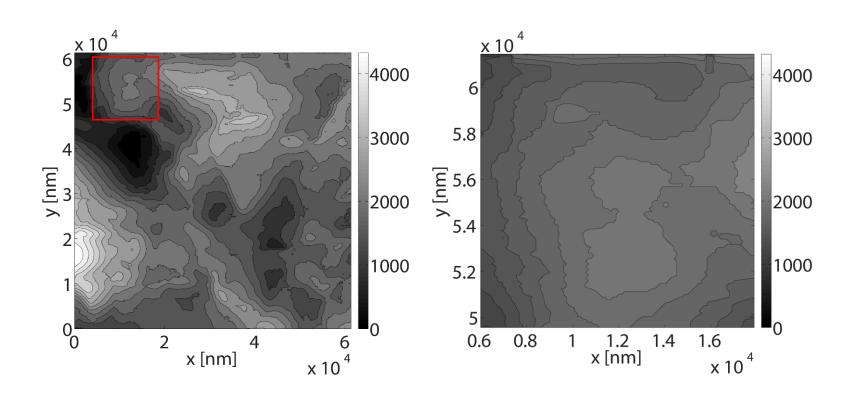


Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal

 Felületi topológia mérése kontakt módban

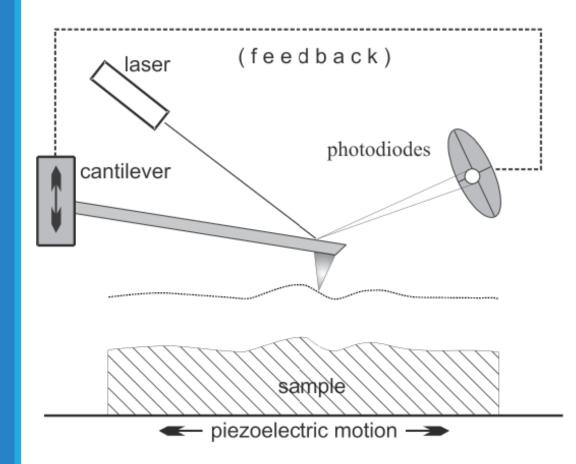


Felületi topológia



Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal

- Felületi topológia mérése kontakt módban
- A felülettől állandó magasságra emelése tű potenciáljának megemelése és kopogtató üzemmódba kapcsolás
- 3. "Tapogatás" közben a tűre ható erő mérése



Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal

TŰRE HATÓ ERŐ KOMPONENSEI

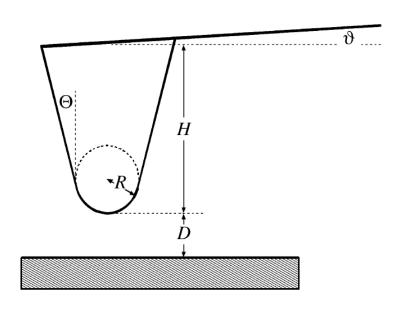
- •Van der Waals erő: $\sim 1/r^6$ állandó távolság \rightarrow konstans erő
- Elektrosztatikus erő:
 minta-tű elrendezésből adódó
 kapacitás elektródái közötti erő
 Számítása: analitikusan, numerikusan
- Minta töltéssűrűsége általi erő: a mérendő mennyiség!

Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal

TŰRE HATÓ ERŐ KOMPONENSEI

- •Van der Waals erő: $\sim 1/r^6$ állandó távolság \rightarrow konstans erő
- Elektrosztatikus erő:
 minta-tű elrendezésből adódó
 kapacitás elektródái közötti erő
 Számítása: analitikusan, numerikusan
- Minta töltéssűrűsége általi erő: a mérendő mennyiség!

KAPACITÁS ANALITIKUS MODELLJE



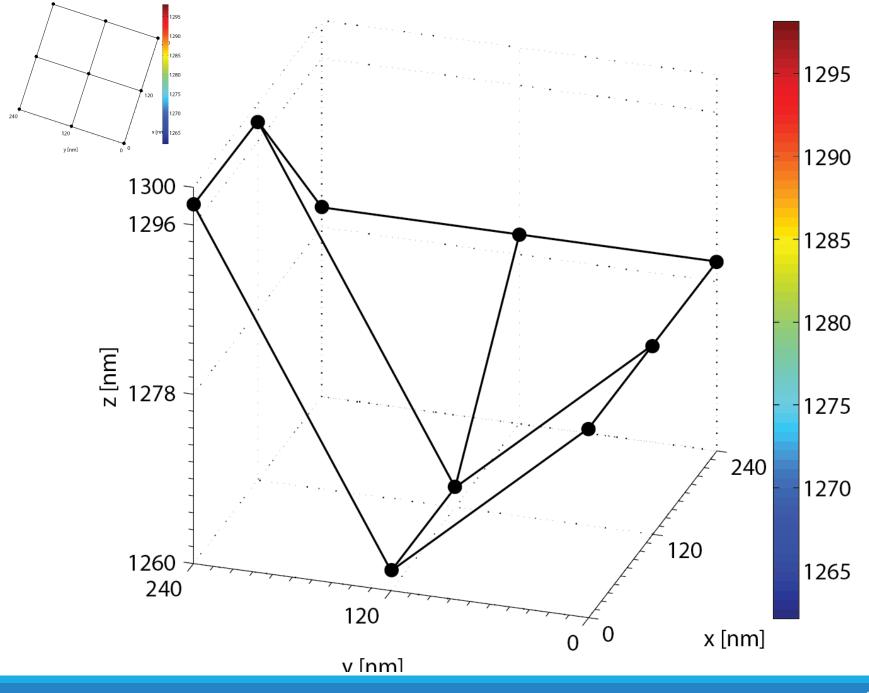
$$F_s = -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}D} = -\frac{\mathrm{d}(CV^2/2)}{\mathrm{d}D} = -\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}D}V^2$$

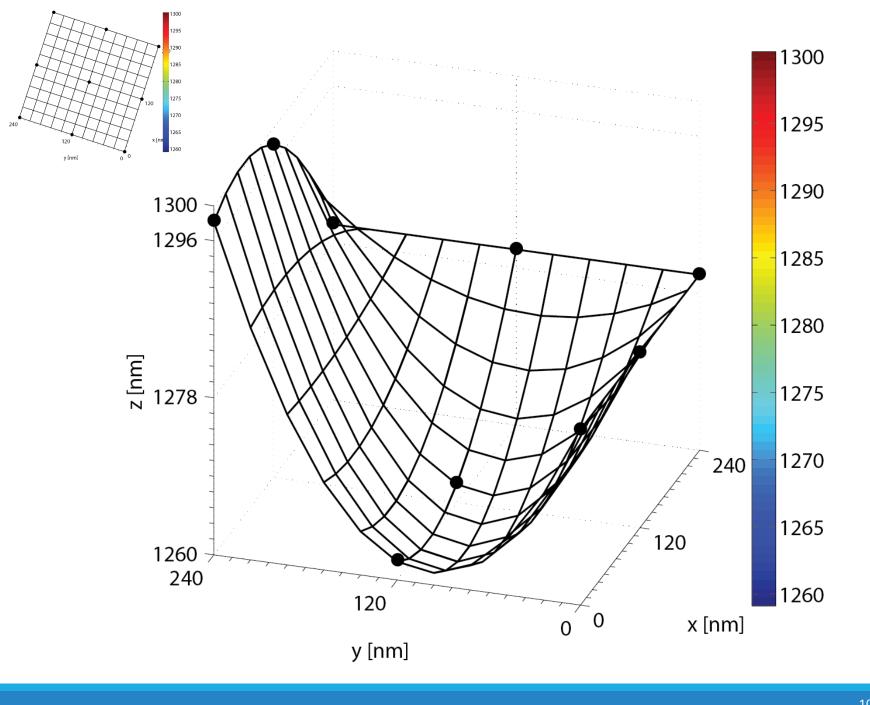
Matematikai modell formalizálása

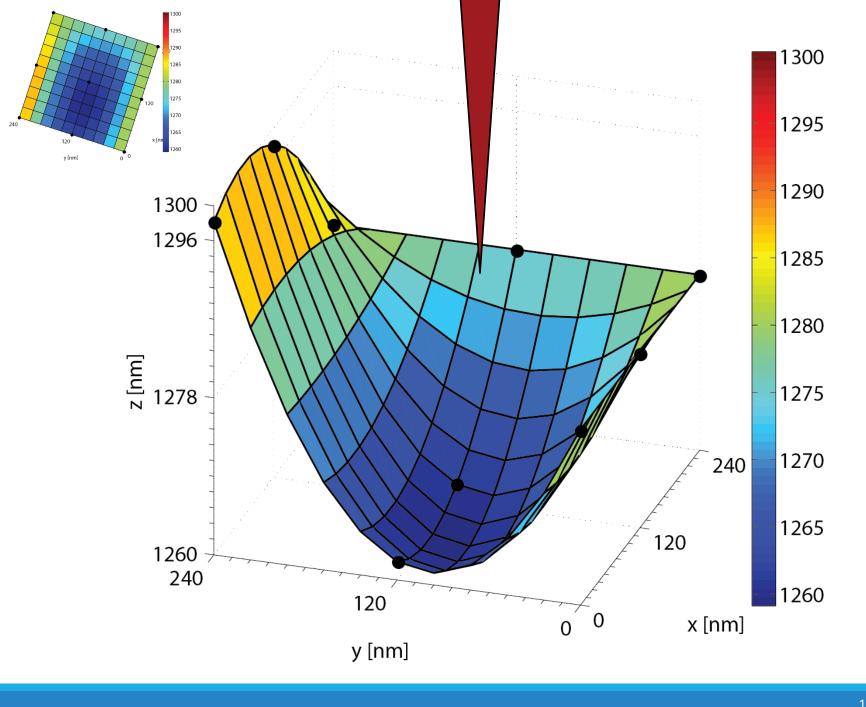
- •Laplace egyenlet $\Delta V(x, y, z) = 0$
- •Diszkretizálás a véges differenciák módszerének használata végett
- •Nem egyenközű háló, ami az AFM felbontására illeszkedik, de interpolációval javítok rajta.

$$d_x = d_y = 120 \ nm \qquad \gg \qquad d_z = 10 \ nm$$

- •Dirichlet feltétel a tűn (V_{tu}) és a mintán $(V_s = 0)$
- Neumann feltétel a többi felületen
- Szimulálandó tér méretének dinamikusan kell változnia
 - Elektrosztatikus erő $1/r^2 \rightarrow \text{Csak}$ a szomszédos pontokat veszem figyelembe (3×3)
 - Magasság "hirtelen" változik → magasabb szimulációs tér

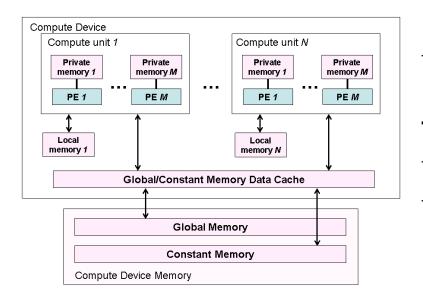






OpenCL keretrendszer

OPENCL ARCHITEKTÚRA



OPENCL MEMÓRIASZINTEK

	Méret	Sebesség	
Host – memória	4< GByte	Kernel előtt & után	
Globális	~1-4 GByte	Lassú	
Lokális	16-32 Kbyte	Gyors	
Privát	~ byte	Regiszter	

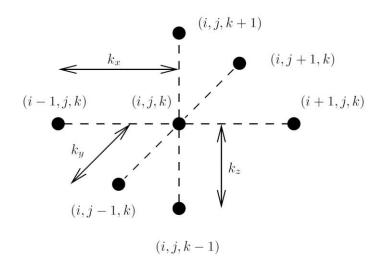
Memóriaszervezés az iteratív megoldás során

•Interpoláció során:

- A topológia részekre bontom és egy work-item-hez rendelem
- A work-item-ek egy work-group-ba csoportosítom → átlapolódás nem okoz gondot

•Szimuláció során:

- Függőlegesen haladok az iterációval
- Adott sor + alatta, felette lévő sor kerül a lokális memóriába a diszkretizálás végett
- Az iteráció végett a potenciál előző és következő értékét tartalmazza.



Eredmények

	Globális tranzakciók száma	Lokális tranzakciók száma	Futási idő	Fajlagos futási idő
Globális memória	$12 \times 12 \times 32.3$	0	5990 ms	410 ms
Lokális memória, ha befér	$12 \times 12 \times 32.3$	$0.48 \times 12 \times 12 \times 30$	2530 ms	170 ms
Lokális memória cachelés	$12 \times 12 \times 32.3$	$2.08 \times 12 \times 12 \times 30$	510 ms	3.5 ms

További feladatok

- Töltéssűrűség számítása
- Validáció
- •Iteratív megoldó helyett direkt megoldó alkalmazása
- Tű formájának modellezése
- Kis vezetőképességű minta és tű modellezése

HIVATKOZÁSOK

- [1] G. Binnig, C. F. Quate, and C. Gerber, "Atomic force microscope," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 56, pp. 930–933, Mar 1986. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.56.930
- [2] B. Vasić, M. Kratzer, A. Matković, A. Nevosad, U. Ralević, D. Jovanović, C. Ganser, C. Teichert, and R. Gajić, "Atomic force microscopy based manipulation of graphene using dynamic plowing lithography," *Nanotechnology*, vol. 24, no. 1, p. 015303, 2013. [Online]. Available: http://stacks.iop.org/0957-4484/24/i=1/a=015303
- [3] H.-J. Butt, B. Cappella, and M. Kappl, "Force measurements with the atomic force microscope: Technique, interpretati-Surface Science and applications," Reports, vol. 59, on 152, 2005. 1–6, pp. 1 _ [Online]. Available: no. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167572905000488
- [4] Y. Martin, C. C. Williams, and H. K. Wickramasinghe, "Atomic force microscope–force mapping and profiling on a sub 100 a scale." *Journal of Applied Physics*, vol. 61, no. 10, pp. 4723–4729, 1987. [Online]. Available: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/61/10/10.1063/1.338807
- [5] H.-J. Butt, "Measuring electrostatic, van der waals, and hydration forces in electrolyte solutions with an atomic force microscope," *Biophys J.*, vol. 60(6), p. 1438–1444., 1991. [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1260203/
- [6] S. Hudlet, M. Saint Jean, C. Guthmann, and J. Berger, "Evaluation of the capacitive force between an atomic force microscopy tip and a metallic surface," *The European Physical Journal B Condensed Matter and Complex Systems*, vol. 2, no. 1, pp. 5–10, 1998. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/s100510050219
- [7] Khronos OpenCL Working Group, *The OpenCL Specification*, *version 1.0*, 6 August 2010. [Online]. Available: http://www.khronos.org/registry/cl/specs/opencl-1.0.pdf